



ساخت شتابدهنده الکترواستاتیکی با بیشینه انرژی ۲۰۰ keV

جواد رحیقی^{*}، مرتضی جعفرزاده خطیبیانی، محمد لامعی رشتی، حسین قدس، آزاده وکیلی، فرهاد ذنوی، حسن زندی، حبیب عزیزی، پیوند طاهرپور

پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: ۱۱۳۶۵-۳۴۸۶، تهران - ایران

چکیده: پس از طراحی و ساخت ستون شتابدهنده با انرژی ۱۵۰ keV، طراحی و ساخت یک سیستم کامل شتابدهنده با انرژی بیشینه ۲۰۰ keV در گروه فیزیک پژوهشکده علوم هسته‌ای انجام شد. در این راستا علاوه بر ساخت ستون شتابدهنده با انرژی ۲۰۰ keV، منبع تغذیه‌ی ۲۰۰ kV، ترانس عایق‌بندی شده‌ی ۲۰۰ kV، چشممه‌ی یونی از نوع بسامد رادیویی، اتصال‌ها و متعلقه‌های مرتبط با هدایت باریکه در خلا، و سیستم کنترل، دیلبانی و ... نیز طراحی و ساخته شدند. در این مقاله به طرح کلی دستگاه و توضیح مختصری از عملکرد اجزای اصلی و مهم آن پرداخته شده است. این شتابدهنده نه تنها می‌تواند یک ابزار سودمند برای پژوهش گران باشد، بلکه در به دست آمدن فناوری‌های مهم در زمینه‌های چشممه‌ی یونی، ولتاژ و خلا بالا نیز سهیم خواهد بود.

کلیدواژه: شتابدهنده‌ی الکترواستاتیک، باریکه یون، منبع ولتاژ بالا

Construction of Electrostatic Accelerator with a Maximum Energy of 200keV

J. Rahighi*, M. Jafarzadeh Khatibani, M. Lamehi Rachti, H. Ghods, A. Vakili, F. Zounobi,
H. Zandi, H. Azizi, P. Taherparvar

Nuclear Science Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran – Iran

Abstract: Following the successful design and construction of a 150keV accelerator tube, the construction of a 200keV electrostatic accelerator system at the Physics Department of the Nuclear Science Research School has been completed. This accelerator includes a 200keV accelerator tube, a high voltage power supply capable of supplying 200kV at 10mA current and a 200kV isolating transformer. An RF type ion source with a system for the control of ion beam could provide ions to the accelerator system. The vacuum system employed is a turbo molecular pumping system coupled with a mechanical rotary pump, where they can provide clean vacuum in the order of 7-10 Torr. In this paper the design criteria and some technical details of the construction of the accelerator system are presented. The construction of this accelerator provides a useful tool for research in various fields and gives an opportunity for the Iranian industry to develop and build accelerator components such as RF, vacuum and accelerator control systems.

Keyword: Electrostatic Accelerator, Ion Beam, High Voltage Power Supply



توسط یک منبع ولتاژ از نوع کوکرافت والتون تولید می‌شود، از طریق مقاومت‌های تقسیم‌کننده ولتاژ به الکترودهای ستون شتابدهنده متصل می‌شود. در اثر تولید میدان الکترواستاتیکی، انرژی یون‌های تشکیل‌دهنده باریکه‌ی یونی تا 200 keV افزایش می‌یابد. این یون‌ها طول شتابدهنده و لوله‌ی هدایت‌گر باریکه را تحت شرایط خلا $^{-6}$ 10 تور پیموده و در نهایت بر هدف موردنظر که در محفظه‌ی مخصوص آن نصب شده است تابانیده می‌شوند.

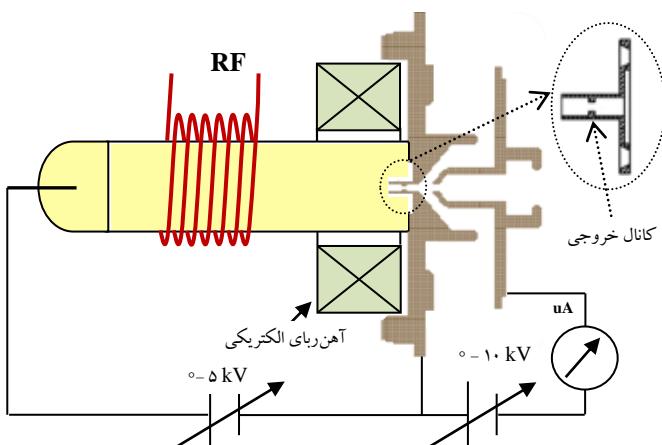
۳. اجزای شتابدهنده ES-200

۱.۳ چشمی یون

از میان انواع مولدات یون، در این شتابدهنده مولد یون از نوع بسامد رادیویی^(۱) به دلیل پیچیدگی کمتر، زیاد بودن نرخ تولید یون‌های اتمی نسبت به یون‌های مولکولی، سهولت به کارگیری در شتابدهنده‌ی الکترواستاتیکی، قابلیت کارکرد مناسب در خلا $^{-5}$ از مرتبه 10 تور، مصرف کم گاز و جریان نسبتاً زیاد باریکه انتخاب شد. طرح وارهی این مولد یون در شکل ۱ نشان داده شده است.

اجزای اصلی این مولد یون عبارت‌اند از:

- محفظه‌ی اصلی از جنس شیشه‌ی پیرکس به شکل استوانه‌ی به طول 23 سانتی‌متر و به قطر 2 سانتی‌متر.
- الکترود خارج از جنس تنگستن.
- منبع تغذیه‌ی ولتاژ بالا با ولتاژ 5 kV به منظور خارج کردن یون‌ها.
- نوسان‌ساز و تقویت‌کننده‌ی 70 مگاهرتز با توان تقریبی 100 وات.



شکل ۱. طرح وارهی چشمی یون.

۱. مقدمه

شتابدهنده‌ها امروزه به صورت ابزار بسیار مفیدی برای پژوهش در علوم بنیادی و کاربردی درآمده‌اند، این ابزار، کاربردهای متنوعی در زمینه‌های فنی و صنعتی دارد. طبق برآوردهای صورت گرفته، حدود 26000 شتابدهنده در سراسر جهان وجود دارد که از این تعداد تنها حدود 1% با انرژی بالاتر از 1 GeV صرفاً برای پژوهش‌های بنیادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، 44% برای مقاصد پرتودرمانی، 41% برای کاشت یون و 4% نیز برای پژوهش در زمینه‌های پزشکی به کار گرفته می‌شوند [۱]. در این بین شتابدهنده‌های الکترواستاتیکی برخلاف سایر انواع شتابدهنده‌ها که از میدان الکتریکی متغیر برای شتاب دادن به ذرات باردار استفاده می‌کنند، به دلیل بهره بردن از یک منع ولتاژ ثابت و ایجاد میدان الکتریکی ثابت، از پیچیدگی نسبتاً کمتری و در نتیجه از هزینه‌ی پایین‌تری برای ساخت، تجهیز و نگهداری برخوردارند. این امر موجب رواج این دسته از شتابدهنده‌ها در بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی و پزشکی شده است. شتابدهنده‌های الکترواستاتیکی عموماً در مواردی استفاده می‌شوند که باریکه با کیفیت بالا، انرژی نسبتاً کم اما با ثبات بالا مورد نیاز باشد. همچنین توانایی شتابدهنده‌های الکترواستاتیکی برای شتاب دادن به طیف وسیعی از یون‌ها مزیت دیگر این نوع شتابدهنده‌ها محسوب می‌شود. شتابدهنده‌ی الکترواستاتیکی ES-200 یک شتابدهنده‌ی الکترواستاتیکی با دامنه‌ی کاربرد وسیع است که برای پژوهش‌های فیزیک هسته‌ای پایه، فیزیک شتابدهنده و کاربردهای تشخیصی در حوزه‌های مختلف صنعت یون نشانی، پزشکی و آموزشی استفاده می‌شود.

آن‌چه در این مقاله بدان پرداخته می‌شود گزارشی از ساخت شتابدهنده‌ی الکترواستاتیکی و مروری بر نحوه عملکرد و مشخصه‌های اجزای اصلی تشکیل‌دهنده‌ی آن است.

۲. اصول کار

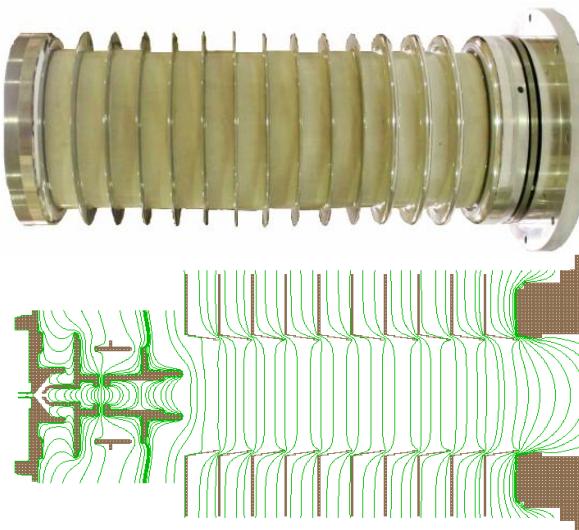
در این شتابدهنده یون‌های مثبت که توسط مولد یون تولید می‌شوند، تحت اثر میدان الکتریکی ناشی از اعمال ولتاژ 5 kV – 10 kV پس از خروج از روزنیه مجرای خروجی یون وارد ستون شتابدهنده شده، تحت اثر لزهای الکترواستاتیکی طبقات اول شتابدهنده به صورت باریکه‌ی یونی پیرامحور در می‌آیند. قطر این باریکه با تغییر در ولتاژ اعمالی (در محدوده 0 تا 10 kV) به اولین الکترود تشکیل‌دهنده‌ی لنز، تغییر می‌کند. ولتاژ 200 kV که



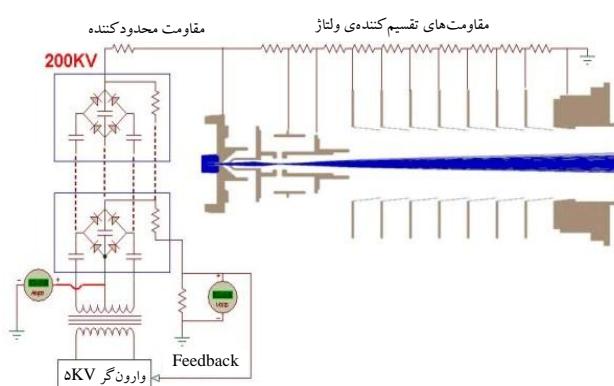
محوری و ناهمگن تولید کند. این میدان باعث فشرده شدن بارهای مثبت در پلاسما، حول محور چشمی یون و ثانیاً باعث دور شدن الکترون‌ها از محور و افزایش اندرکنش میان الکترون‌ها و اتم‌های گاز داخل محفظه می‌شود.

۲.۳ ستون شتاب‌دهنده با ولتاژ بیشینه 200kV

ستون شتاب‌دهنده، که طولی در حدود 50 متر دارد، از 14 حلقه‌ی سرامیکی و 13 الکترود تشکیل شده است (شکل ۲). الکترودها و حلقه‌های سرامیکی با چسب مخصوص خلاً به قطعات سرامیکی چسبانده شده‌اند. ولتاژ هر الکترود $1/12$ ولتاژ است (شکل ۳).



شکل ۲. ستون شتاب‌دهنده 200kV .



شکل ۳. نحوه اتصال منبع ولتاژ بالا.

- آنتن انتقال توان امواج الکترومغناطیسی و مدار تطبیق امپدانس.
- کanal خروجی یون که از آن برای تزریق گاز نیز استفاده می‌شود.
- غلاف کanal خروجی از جنس کوارتز.
- آهن‌ربای الکتریکی با شدت میدان 10^{-3} Tesla .

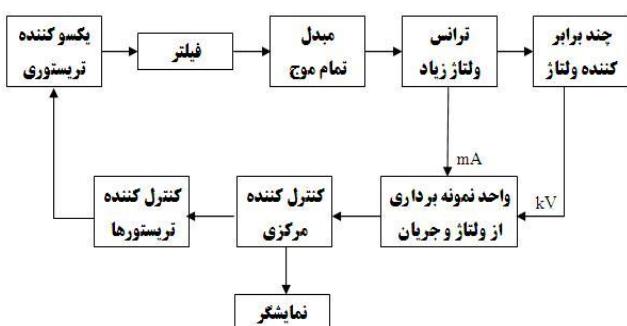
پارامترهای اصلی این نوع مولد که عبارت‌اند از: بسامد و توان تقویت کننده‌ی بسامد رادیویی، نوع آنتن، جنس و طول محفظه‌ی شیشه‌ای به یک‌دیگر وابسته بوده و انتخاب آن‌ها با توجه به امکانات آزمایشگاه به انجام رسید. بسامد و توان تقویت کننده‌ی بسامد رادیویی به عنوان مشخصه‌ی اصلی به صورت پیش‌فرض 70 مگاهرتز و 100 وات در نظر گرفته شد. بسامد کار تقویت کننده‌های مولد یون عموماً بین 20 تا 450 مگاهرتز بود. هر چه بسامد کار کم‌تر باشد، هزینه‌ی ساخت تقویت کننده و پیچیدگی کار به همان اندازه کم‌تر می‌شود. اما با افزایش بسامد تقویت کننده به دلیل این که مسیر حرکت الکترون‌هایی که تحت تأثیر میدان الکترومغناطیسی قرار گرفته‌اند، افزایش می‌باید، تولید یون نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر توان کم‌تری برای تولید یون مورد نیاز است. هم‌چنین علاوه بر آن با افزایش بسامد می‌توان از محفظه‌ی مولد یون با طول کوتاه‌تر استفاده نمود.

با در نظر گرفتن این موضوع که در فشار 10^{-3} میلی‌بار که نقطه‌ی کار این نوع مولد یون است، میانگین پویش آزاد یون‌ها بسیار بیش‌تر از طول محفظه است، لذا بازترکیب یون‌ها در داخل محفظه نسبت به امکان بازترکیب آن‌ها در اثر برخورد با جداره‌ی محفظه، قابل چشم‌پوشی است. بنابراین مناسب‌ترین ماده برای محفظه‌ی اصلی، ماده‌ی عایقی است که ضربیت بازترکیب یون‌ها در اثر برخورد با آن کم‌تر از سایر مواد است. پیرکس با ضربیت 2×10^{-5} در مقایسه با کوارتز با ضربیت 7×10^{-4} و آلومینیم اکسید با ضربیت 0.33 ، برای این منظور انتخاب شد [۲]. با اعمال ولتاژ حدود 5kV تا 20kV به الکترود خارج کن، می‌توان مقدار خروج یون‌ها از مولد یون به داخل ستون شتاب‌دهنده را کنترل نمود. این الکترود از جنس تنگستن بوده و توسط یک قطعه از جنس کوارتز از یون‌ها مجزا شده است. در انتهای چشمی یون و ابتدای دهانه‌ی خروجی یک آهن‌ربای الکتریکی با شدت میدان حدود 10^{-3} Tesla قرار داده شد تا یک میدان مغناطیسی استاتیکی

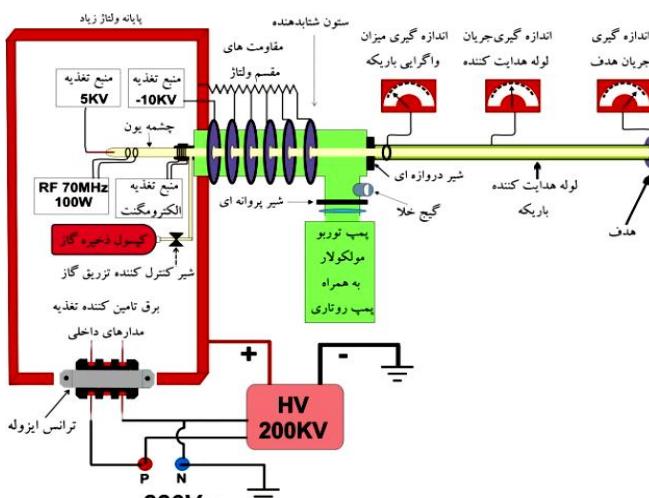


جدول ۱. مشخصه های فنی منبع ولتاژ بالا

حداکثر جریان ورودی ۲۰A	سامد ورودی برق شهر ۵۰HZ	ولتاژ ورودی ۲۲۰V
ریل	بیشینه جریان خروجی ≤ ۵%	تعداد فاز تک فاز
یکسوکننده	سامد سونیچ	ولتاژ خروجی
تمام موج نیم تریستوری	۶,۳MHz	۲۰۰ kV DC
DC/AC مبدل	قطیبیت ولتاژ خروجی	شیوه کار
IGBT تمام موج	مشت	پیوسته



شکل ۴. نمودار منبع تغذیه‌ی ۲۰۰ kV



شکل ۵. محل قرار گیری ترانس عایق‌بندی شده.

که در آن P فشار بر حسب تور، T دما بر حسب کلوین، k ثابت بولتزمن و d قطر مولکول‌های گاز است. به راحتی می‌توان محاسبه نمود که پویش آزاد متوسط برای مولکول‌های گاز نیتروژن که ۸۰٪ حجم هوا را شامل می‌شود و قطر مولکول‌های آن در حدود ۳۷ آنگستروم است در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و فشار ۱ تور تقریباً $1 \times 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$ است. در واقع می‌توان گفت $P/T \approx 1$.

۳.۳ مولد ولتاژ بالا از نوع کوکرافت - والتون با ولتاژ بیشینه

۲۰۰ kV

برای ایجاد ولتاژهای بسیار بالا با جریان کم یکی از بهترین روش‌ها - روش چند برابر کننده دیودی - استفاده شد. ویژگی‌های این مدار عبارت‌اند از:

- سادگی سیستم؛
 - قابلیت افزایش ولتاژ خروجی تنها با اضافه کردن تعداد طبقات، دیود خازنی؛
 - کم حجم بودن نسیی سیستم در مقایسه با دیگر سیستم‌ها؛
 - استفاده از فن آوری نسبتاً ساده در ایجاد ولتاژ بالا؛
 - امکان تعدیلی کردن سیستم، این امکان باعث افزایش سرعت نصب و راه‌اندازی و رفع عیب می‌شود.
- در این سیستم با استفاده از یک مدار چند برابر کننده شامل طبقه (شکل ۳) ولتاژ جریان مستقیم ۵ تا ۲۰۰ کیلوولت تولید می‌شود. مشخصات فنی و نمودار این منبع ولتاژ در جدول ۱ و شکل ۴ آورده شده است.

۴.۳ ترانس عایق‌بندی شده

یکی از قسمت‌های چالش برانگیز در ساخت این شتابدهنده، تأمین ولتاژ تغذیه‌ی مورد نیاز برای مدارهای الکترونیکی نصب شده در داخل پایانه ولتاژ بالا (HV) بود. با توجه به این که پایانه‌ی ولتاژ بالا مطابق شکل ۵ باید از بدنه‌ی دستگاه و زمین مجزا شده باشد لذا طراحی و ساخت یک ترانس با نسبت ۱:۱ در دستور کار قرار گرفت.

در ساخت این ترانس به منظور عایق‌سازی آن، سیم پیچ ثانویه در محفظه‌ای که با نوعی رزین به طور کامل پر شده است، قرار داده شد (شکل ۵). مدل‌های مختلفی از این ترانس ساخته شد که در فرایند ساخت آن‌ها روش‌های گوناگونی در تزریق رزین برای عایق‌کاری سیم پیچ‌های ثانویه به کار گرفته شد و بارها تحت ولتاژ ۲۰۰ کیلو ولت مورد آزمایش قرار گرفت، تا نتیجه‌ی دلخواه حاصل شود.

۵.۳ سیستم خلا و تزریق گاز

پویش آزاد متوسط یا میانگین مسافتی که یک مولکول گاز بدون برخورد با دیگر مولکول‌ها در فاصله‌ی بین دو برخورد متوالی طی می‌کند در حالت کلی چنین به دست می‌آید [۳]

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}N\pi d^3} = \frac{kT}{\sqrt{2}P\pi d^3} \quad (1)$$



۶.۳ اندازه‌گیری جریان باریکه

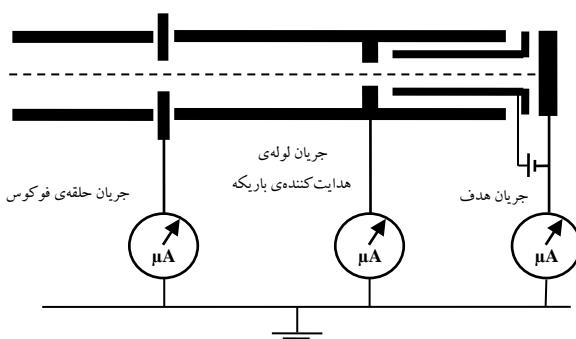
جریان باریکه و میزان واگرایی آن مشخصه‌هایی هستند که در شتاب‌دهنده‌ها با روش‌های مختلف قابل اندازه‌گیری هستند. در شتاب‌دهنده‌ی ES-200 مطابق شکل ۶ جریان ناشی از برخورد باریکه را در سه نقطه‌ی مختلف از ستون شتاب‌دهنده و لوله‌ی هدایت کننده می‌توان اندازه‌گیری کرد. برخورد باریکه‌ی یون‌های مثبت با هدف منجر به جدا شدن الکترون‌های سطحی در محل برخورد و افزایش بار سطحی هدف می‌شود. در نتیجه‌ی چنین فرآیندی، جریان اندازه‌گیری شده بیش از جریان واقعی نشان داده خواهد شد. برای جلوگیری از چنین خطای در اندازه‌گیری باریکه تمهیدات لازم برای بازگرداندن الکترون‌های سطحی به هدف از طریق اعمال ولتاژ مثبت در حد چند ده ولت در اطراف هدف پیش‌بینی شد.

جریان باریکه‌ی اندازه‌گیری شده با این روش در شتاب‌دهنده‌ی ES-200 در حدود $500 \mu\text{A}$ تا $600 \mu\text{A}$ است که نسبت به شرایط چشممه‌ی یونی می‌تواند متفاوت باشد.

۷.۳ واحد کنترل سیستم

به منظور سهولت در کاربری این شتاب‌دهنده، همه‌ی ابزارهای کنترلی و ناظری موردنیاز، به صورت مرکز در داخل یک پانل به ابعاد $170\text{cm} \times 60\text{cm}$ نصب شد. در شکل ۷ تصویر این پانل کنترل آورده شده است. اجزای این پانل کنترل عبارت‌اند از:

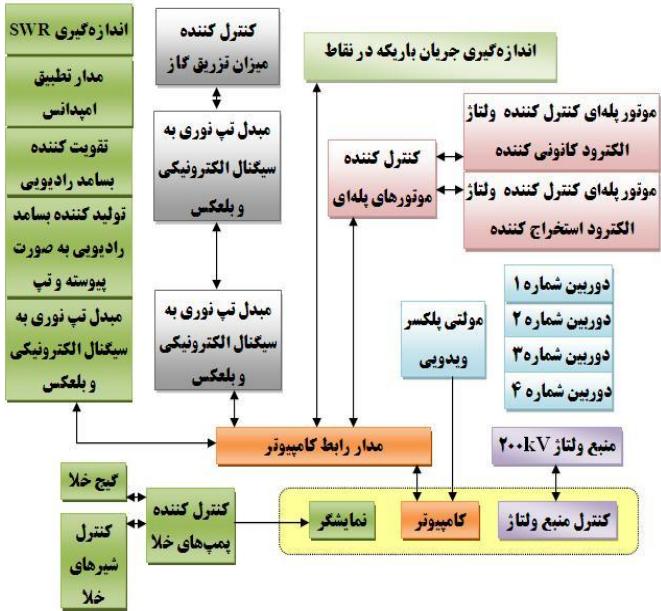
- یک کامپیوتر به منظور برقراری ارتباط دو طرفه با مدارهای واسطه‌ی کنترلی و مشاهده‌ی تصویر دوربین‌های ناظری بر روی نمایش‌گر؛
- قسمت کنترلی مدار مولد ولتاژ بالا؛
- نمایش‌گر مقدار خلا؛
- کلیدها و فیوزها.



شکل ۶. نحوه‌ی اندازه‌گیری جریان باریکه.

در یک شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی، یون‌ها طی فرایند تولید در مولد یون و افزایش انرژی در ستون شتاب‌دهنده تا برخورد با هدف، مسیری در حدود چند متر را طی می‌کنند. در طی این مسیر برخورد یون‌های موجود در باریکه با مولکول‌های گازهای موجود در فضای داخلی شتاب‌دهنده و یا پراکنده‌گی آن‌ها از این مولکول‌ها موجب کاهش جریان و کیفیت باریکه می‌شود. به عبارت دیگر، فشار فضای داخلی شتاب‌دهنده باید به اندازه‌ای باشد که پویش آزاد متوسط یون‌ها (λ) به بیش از چند متر برسد. با استفاده از رابطه‌ی (۱) حداقل فشار باید از مرتبه‌ی 10^{-6} تور باشد. برای رسیدن به این خلا می‌توان از پمپ‌های پخشی و یا توربومولکولی به همراه یک پمپ مکانیکی دورانی استفاده کرد. اگر چه پمپ‌های پخشی نسبت به پمپ‌های توربومولکولی از قیمت به مراتب کم‌تری برخوردارند اما بخار روغنی که به هنگام کار از این پمپ‌ها متصاعد می‌شود در صورت عبور از تله‌ی سرد^(۲) می‌تواند به میزان بسیار کم وارد محیط شتاب‌دهنده شده و لایه‌ی نازکی از روغن بر روی سطوح داخلی و از جمله هدف تشکیل دهد که موجب افزایش زمان پمپ کردن و کاهش کیفیت باریکه به هنگام برخورد با هدف می‌شود. به دلایلی که ذکر شده در ساخت این شتاب‌دهنده از یک پمپ توربومولکولی با دهانه 100 میلی‌متری و سرعت پمپ کردن تقریباً 170 لیتر بر ثانیه به همراه یک پمپ دورانی دو مرحله‌ای با سرعت پمپ کردن 17 لیتر بر دقیقه استفاده شد. با توجه به حجم فضای داخلی شتاب‌دهنده پس از گذشت حدود یک ساعت از آغاز پمپ کردن، خلا به حدود 10^{-5} تور رسید، که با ادامه‌ی کار پمپاژ خلا بهتر از 2×10^{-6} تور شد. این نقطه برای تزریق گاز به مولد یون مناسب است.

به منظور تولید یون باید مقداری گاز با دقت بسیار زیاد به داخل مولد یون تزریق شود. مقداری از این گاز به طور ناخواسته وارد ستون شتاب‌دهنده شده موجب افت خلا و افزایش مصرف گاز می‌شود. در این شتاب‌دهنده برای تزریق گاز از یک کنترل کننده‌ی جرمی^(۳) استفاده شد. این وسیله در واقع ترکیبی از یک شیر سلونویید بسیار سریع به همراه مدار اندازه‌گیر جرم عبوری و یک کنترل کننده‌ی PID برای کنترل دقیق جریان گاز است که می‌تواند میزان عبور گاز را (بسته به نوع آن) از صفر تا 5SCCM تغییر دهد.



شکل ۸. نمودار سیستم کنترل شتاب دهنده.



شکل ۷. پانل کنترل شتاب دهنده.

۳.۷.۳ مدار رابط نوری برای برقراری ارتباط دوطرفه بین کامپیوتر و کنترل کننده میزان تزریق گاز

با توجه به این که کنترل کننده گاز باید در داخل پایانه ولتاژ بالا قرار داده شود، لذا برقراری ارتباط با آن تنها با استفاده از فیبر نوری امکان‌پذیر است. بنابراین مدارهای مبدل علامت‌های الکتریکی به نوری و بالعکس طراحی و ساخته شد، به طوری که کاربر بتواند از طریق سطح مشترک گرافیکی در نرم‌افزار کنترلی شتاب‌دهنده و این رابطه‌های نوری-الکترونیکی به سهولت حجم گاز تزریق شده به چشممهی نوری را با دقیقی از مرتبه ۰،۱ SCCM کنترل نماید. فشار گاز داخل مخزن و دمای شیر کنترل کننده جرمی نیز مشخصه‌هایی هستند که در نرم‌افزار به نمایش درمی‌آیند.

۴.۷.۳ مدار مولد تپ برای تولید باریکه‌ی یونی با اعمال تپ‌هایی با پهنه‌ای دست کم 10 mS به قسمت نوسان‌ساز قسمت بسامد رادیویی RF، می‌توان دامنه‌ی امواجی که به چشم‌یونی اعمال می‌شوند را تعديل نمود. در نتیجه تولید و تزریق یون‌ها از حالت پیوسته به حالت تپی تغییر می‌باید. مداری که برای این کار طراحی و ساخته شد از یک ریز-کنترل کننده، فیبر نوری و ملحقات آن تشکیل شده است و کاربر می‌تواند به کمک نرم‌افزار کنترلی، چشم‌های یون را با پهنه‌ای تپ دلخواه (بزرگ‌تر از 10 mS تا پیوسته) تنظیم نماید.

همان طور که در شکل ۸ دیده می‌شود واحد کنترل از اجزای مختلفی تشکیل شده است که ارتباط بیشتر آن‌ها با کامپیوتر، از طریق یک مدار واسطه با استفاده از درگاه موازی (RS-232) برقرار می‌شود.

۱۷.۳ مدار اندازه‌گیری جریان‌های حاصل از برخورد باریکه در نقاط مختلف

این قسمت از ۳ مدار تبدیل جریان به ولتاژ در روش انتگرالی، به همراه ۳ کانال مبدل قیاسی به عددی ۱۰ بیتی داخلی یک ریزکنترل کننده، تشکیل و برای اندازه‌گیری جریان‌های A تا 1 mA تنظیم شده است. در عمل به دلیل وجود نوسان در جریان باریکه با دقت تقریباً $10\text{ }\mu\text{A}$ می‌توان مقدار جریان‌ها را اندازه‌گیری نمود.

برای تنظیم منابع تغذیه‌ی متصل به الکترودهای کانوئی کننده و خارج کننده، از ۳ موتور پله‌ای به همراه ۳ عدد واریاک استفاده شد. برای کنترل این موتورها مداری طراحی و ساخته شد که علاوه بر ارسال فرمان کنترل و راهاندازی موتورها، موقعیت زاویه‌ای محور آن‌ها را نیز اندازه‌گیری کرده و به مدار واسطه ارسال می‌نماید تا در اختیار کاربر قرار گیرد.



- استفاده از مدار تطبیق امپدانس که موجب افزایش کارآیی چشمی یونی می‌شود. در نمونه‌ی اصلی به دلیل فقدان این بخش، چشمی یون تنها در شرایط خاصی دارای عملکرد مطلوب بود و هر گونه تغییری در میزان تزریق گاز یا خلا کل سیستم موجب از کار افتادن وقت چشمی یون می‌شد.
- استفاده از تقویت‌کننده‌ی ترانزیستوری به جای تقویت‌کننده‌ی لامپی که علاوه بر موجود بودن در بازار داخل، در شرایط کاری تبی دارای مشخصات به مراتب بهتری نسبت به نمونه‌ی اصلی است که بر پایه‌ی لامپ سامد رادیویی طراحی شده بود.

پی‌نوشت‌ها:

۱. RF Ion Source
۲. Cold Trap
۳. Mass Flow Controller

مراجع‌ها:

1. T. Feder, Accelerator school travels university circuit, http://controls.als.lbl.gov/als_physics/Fernando/FSannibaleWebSite/Teaching/USPAS/USPASHighLights/PhysicsTodayUSPAS_Feb_2010.Pdf.
2. C. D. Moak, H. Reese, M. W. Good, Nucleonics 9 (1951).
3. R. Reid, Vacuum Science and Technology in Accelerators Cockcroft Institute Lectures (2010).

۴. کاربردهای شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی ES-200

- صنعت: کاشت یون، کنترل فرایندهای صنعتی هم‌چون کنترل فرایند تولید سیمان، تجزیه و تحلیل کیفیت زغال سنگ، و ...
- پزشکی: اندازه‌گیری عناصر کم مقدار در بدن و مطالعات مربوط به تغذیه و رژیم غذایی.
- محیط زیست: سنجش پسماندهای هسته‌ای.
- اندازه‌گیری ژئوفیزیکی مانند: نقشه‌برداری، تجزیه‌ی مواد معدنی و کانی‌ها، اکتشاف نفت.

۵. نتیجه‌گیری

طراحی و ساخت سیستم کامل شتاب‌دهنده با انرژی بیشینه‌ی 200 keV را می‌توان گامی مؤثر و رو به جلو در گسترش فن‌آوری‌های مربوط به این شاخه از علم در کشور محسوب نمود، که علاوه بر آن ابزار سودمندی در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز علمی قرار می‌دهد.

نکته مهمی که جا دارد در انتها به آن اشاره شود مواردی است که در شتاب‌دهنده‌ی ES-200 در مقایسه با نمونه‌های خارجی آن (الگوی اصلی برای برگردان و ساخت) ارتقاء یافته است. برخی از این موارد عبارت‌اند از:

- استفاده از پمپ توربومولکولی به جای پمپ پخشی برای رسیدن به شرایط خلاً عاری از بخار روغن؛
- افزایش انرژی شتاب‌دهنده از 150 keV به 200 keV ؛
- استفاده از کنترل‌کننده‌ی جرمی به جای شیر نشی پالادیم که این امکان را به کاربر می‌دهد تا بتواند از هر گاز دیگری برای تزریق به چشمی یون و شتاب دادن به آن‌ها استفاده کند. در حالی که در نمونه‌ی اصلی شیر نشی پالادیم تنها به گاز هیدروژن و ایزوتوپ‌های آن اجازه عبور می‌دهد. به عبارت دیگر تنها می‌توان باریکه‌ای از یون‌های هیدروژن تولید نمود. هم‌چنین سرعت و دقت کنترل‌کننده‌های جرمی به مراتب از نمونه‌های پالادیمی بیشتر است.
- استفاده از کامپیوتر برای کنترل و مشاهده متغیرهای کنترلی که افودن امکاناتی هم‌چون استفاده از الگوریتم‌های مبتنی بر کنترل خودکار را در آینده میسر می‌سازد.



ساخت شتابدهنده الکترواستاتیکی با بیشینه ابرزمی 200 keV